МАГНИТНОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ГЕТЕРОСТРУКТУР Ge/Ge_{1-x}Si_x

А. В. Черненко*

Институт физики твердого тела Российской академии наук 142432, Черноголовка, Россия

Н. Г. Калугин, О. А. Кузнецов

Институт физики микроструктур Российской академии наук 603600, Нижний Новгород, Россия

Поступила в редакцию 30 октября 1997 г.

Впервые исследована люминесценция гетероструктур $Ge/Ge_{1-x}Si_x$ в магнитном поле до 14 Тл при гелиевых температурах. Показано, что наблюдаемые линии люминесценции обусловлены излучением свободных и связанных на примесях экситонов из слоев Ge. Определена величина диамагнитного сдвига квазидвумерного экситона. Из экспериментальных данных получена оценка размера экситона в плоскости квантовой ямы 75-90 Å.

1. ВВЕДЕНИЕ

Интерес к изучению оптических свойств двумерных Si/Ge-структур связан, в первую очередь, с перспективой их интегрирования в традиционную кремниевую микротехнологию, в том числе в качестве источников и детекторов излучения (см. обзор [1]). Кроме того, качественные структуры на основе Si/Ge могут представлять большой интерес при исследовании многочастичных эффектов в системе фотовозбужденных экситонов. Значительно меньшая по сравнению со структурами на основе A_3B_5 скорость излучательной рекомбинации позволяет рассчитывать на большие времена жизни экситонов ($\tau \sim 10^{-5}$ – 10^{-6} с). Большие τ позволили бы электронно-дырочной системе остыть до температуры близкой к температуре кристаллической решетки. В связи с этим стоит отметить появившееся недавно сообщение о наблюдении в спектре люминесценции квантовой ямы Si/SiGe/Si линии, соответствующей рекомбинации квазидвумерных экситонных молекул (биэкситонов) в [2].

После работы [3], где впервые наблюдалась люминесценция экситонов из $Si/Si_{1-x}Ge_x/Si$ -квантовых ям, появилось большое количество исследований по люминесценции этих структур. Природа и свойства наблюдаемых в спектре линий были детально изучены. В то же время люминесценции гетероструктур Ge/GeSi посвящены только две работы [4, 5]. Видимые в спектре люминесценции гетероструктур Ge/GeSi линии приписывалась рекомбинации свободных и, возможно, связанных на примесях экситонов из слоев Ge, линии которых отдельно не разрешались. С низкоэнергетической стороны от доминирующей в спектре линии заметно «плечо» (x1 на рис. 1, см. также [5]), природа которого осталась неясна, и которое, в принципе, могло бы соот-

^{*}E-mail: chernen@issp.ac.ru



Рис. 1. а) Бесфононные (NP) и сопровождающиеся испусканием LA-фононов компоненты спектров люминесценции для образца № 1 ($d_{Ge} = 120$ Å) при температуре гелиевой ванны $T_b = 2$ K, постоянной накачке Nd:YAG-лазером плотностью W = 30 BT/см² и различных магнитных полях. Плечо с низкоэнергетической стороны от основной линии x^0 обозначено x^1 ; б) спектры люминесценции образца № 2 ($d_{Ge} = 210$ Å) при постоянной накачке Nd:YAG-лазером плотностью W = 55 BT/см², $T_b = 2$ K и различных магнитных полях. Особенности линии люминесценции обозначены x^0 , x^1 , x^2 , x^3 , их максимумы соединены штрихом

ветствовать более связанному, чем экситон, образованию, например, экситонной молекуле.

Как известно из исследований биэкситонов в одноосно деформированном Ge [6], при выполнении условия $\tau_{ex} \gg \tau_s$ (τ_{ex} — время жизни экситона, а τ_s — время его спиновой релаксации) экситонная молекула разрушается магнитным полем, большим чем $B_c = \Delta_M/g\mu_B$ (Δ_M — энергия связи биэкситона). В одноосно деформированном Ge g-фактор экситонов значителен и вызванная магнитным полем диссоциация молекул происходит при $B_c \sim 1.5$ Тл. Такое же поведение биэкситона следует ожидать в интересующем нас случае, что явилось бы надежным способом его идентификации. Отметим, что в деформированном кремнии $\tau_{ex} < \tau_s$ и дестабилизировать биэкситон магнитным полем не удается. Это, видимо, верно и для квазидвумерных биэкситонов в квантовых ямах Si/Si_{1-x}Ge_x/Si. Поскольку диамагнитный сдвиг зависит от размера экситона [7], то для связанных на примесях и локализованных на флуктуациях случайного потенциала экситонов сдвиг линий в зависимости от поля будет меньше, чем для свободных. При надлежащей величине поля это помогло бы разрешить различные линии. Таким образом, измерения магнитнолюминесценции перспективны для выяснения природы наблюдаемых в спектре линий. В данной работе мы сообщаем о первых измерениях магнитолюминесценции гетероструктур Ge/Ge_xSi_{1-x}.

2. ЭКСПЕРИМЕНТ И ОБСУЖДЕНИЕ

В работе исследовались структуры $Ge/Ge_{1-x}Si_x$, выращенные газовым гидридным методом на подложке Ge[111] со следующими параметрами: образец №1 — толщина слоев Ge $d_{Ge} = 210$ Å, период гетероструктуры D = 530 Å, число периодов N = 72, x = 12.3%, период кристаллической решетки в плоскости слоя a = 5.638 Å и №2 $d_{\text{Ge}} = 120$ Å, D = 420 Å, N = 262, x = 14%, a = 5.629 Å. Остаточная концентрация примесей *п*-типа в слоях Ge была порядка (1-2)·10¹³ см⁻³. Подробную информацию об образцах и особенностях роста структур можно найти в статье [5] и ссылках к ней. Исследуемые в данной работе структуры №1 и №2 обозначены в [5] соответственно как № 261 и № 262. В качестве возбуждающего использовалось излучение непрерывных Nd:YAG- и Ar⁺-лазеров (с длиной волны λ соответственно 1064 и 488 нм). Спектры анализировались решеточным монохроматором и детектировались охлаждаемым германиевым фотоприемником в режиме синхронного детектирования. Измерения в магнитном поле проводились в криостате со сверхпроводящим соленоидом в геометрии Фарадея. Подведение излучения к образцу и регистрация сигнала люминесценции осуществлялись с помощью оптического световода. В измерениях без магнитного поля также использовался оптический криостат.

Энергетические спектры электронов и дырок в гетероструктурах Ge/Ge_{1-x}Si_x были рассчитаны в работе [8]. Расчеты показывают, что для данных структур слои Ge являются квантовыми ямами как для дырок, так и для электронов. Определенные из спектров люминесценции положения линий хорошо согласуются с расчетными [5]. Постоянные решеток материалов, формирующих ямы и барьеры (Ge и GeSi), заметно различаются (до ~ 0.4%), что приводит к напряжению двумерных слоев. Слои Ge испытывают сжатие в плоскости квантовой ямы, которое можно представить как результат гидростатического сжатия и одновременно одноосного растяжения вдоль оси [111]. Воспользовавшись формулами работы [8], находим, что в образце №2 ($d_{Ge} = 120$ Å) слои Ge испытывают эквивалентное одноосное растяжение $P \simeq 8.5$ кбар, а образец №1 ($d_{Ge} = 210$ Å) — $P \simeq 5.8$ кбар. Одноосное растяжение ($\Delta = dS_{44}/\sqrt{3} \simeq 3.6$ мэВ/кбар, d — деформационный потенциал, S_{44} — коэффициент податливости [9]) и размерное квантование приводят к межподзонному расщеплению в валентной зоне порядка 20– 30 мэВ [8].

На рис. 1 приведены спектры люминесценции гетероструктур № 1 и № 2 (соответственно a и δ) при значительной накачке и различных значениях магнитного поля, перпендикулярного слоям структур. Интенсивность линий люминесценции растет с магнитным полем B и увеличивается примерно вдвое при B = 12 Тл. Для обеих структур виден слабый сдвиг в сторону больших энергий высокоэнергетического «крыла» линии люминесценции.

Можно заметить, что с ростом магнитного поля интенсивность «плеча» с низкоэнергетической стороны от линии люминесценции № 1 (на рис. 1*a* оно обозначено x1) увеличивается быстрее, чем интенсивность линии x0. На спектрах δ , которые имеют более сложную структуру, чем спектры *a*, видно, что особенности x2 и x3 оформляются в отдельные линии, причем интенсивности низкоэнергетических линий растут в





Рис. 2. Спектр люминесценции образца № 2 при $T_b = 4.2$ К в фиксированном магнитном поле B = 12 Тл при различных мощностях Nd:YAG-лазера

зависимости от магнитного поля быстрее, чем интенсивности линий, расположенных выше по оси энергий. С увеличением магнитного поля на спектрах δ становится заметна особенность, аналогичная x1 на a (на других рисунках она также обозначена x1). Кроме того, оказалось, что интенсивности различных линий в постоянном магнитном поле по-разному зависят от накачки: как это видно из рис. 2, чем ниже по оси энергий расположена линия, тем быстрее увеличивается ее интенсивность с ростом накачки. В спектрах, записанных без магнитного поля, при вариации накачки и температуры интенсивность и положение максимумов всех линий изменяются одинаково. Расстояние между максимумами линий x0 и x1 на рис. 16 порядка 3.4 мэВ, а между максимумами x0 и x2 порядка 7.5 мэВ. При сканировании лазерным лучом по поверхности образца ширина и положение линий не менялись, а их относительные интенсивности изменялись не более чем на 15%.

При возбуждении образца Nd:YAG-лазером (глубина проникновения излучения с $\lambda = 1.064$ мкм ~ 1 μ м, а с $\lambda = 488$ Å ~ 8 нм) интенсивность линии x1 по отношению к x0 оказалась больше, чем в случае с Ar⁺-лазером, как это показано на рис. 3*a*. Это позволило предположить, что различные линии в спектрах обеих структур соответствуют люминесценции, происходящей из разных квантовых ям.

Для того чтобы проверить это предположение, образец № 2 был обработан травящим раствором СР-4А в течение ~ 1 с. На рис. Зб приведены спектры образца № 2 до (1) и после (2) травления. Видно, что линия x^2 исчезла из спектра образца, подвергнутого травлению, а ширина линии x^0 уменьшилась. Этим подтверждается выдвинутое выше предположение.

Параметром, которым могут отличаются отдельные квантовые ямы в гетероструктурах, является их ширина. Сдвиг положения линии экситона при малых изменениях



Рис. 3. а) NP-компоненты спектров люминесценции образца № 1 при $T_b = 4.2$ К при возбуждении Nd:YAG-лазером, W = 80 Вт/см² (1) и Ar⁺-лазером, W = 35 Вт/см² (2). Спектры нормированы на максимум интенсивности линии x0; б) спектры люминесценции образца № 2 до (1) и после (2) травления. Спектры записаны при $T_b = 4.2$ К, накачке Nd:YAG-лазером плотностью W = 50 Вт/см²

ширины ямы L_z есть

$$\Delta E_{ex} = |\delta E_{ex}/\delta L_z| \Delta L_z = \pi^2 \hbar^2 \Delta L_z/(\mu_{||} L_z^3), \quad 1/\mu_{||} = 1/\mu_{||}^e + 1/\mu_{||}^h$$

где μ_{\parallel}^e и μ_{\parallel}^h — приведенные массы электрона и дырки вдоль нормали к слоям, m_0 — масса электрона [9]. Отсюда найдем, что линии x1 и x2 соответствуют люминесценции из близких к поверхности квантовых ям, ширины которых различается на соответственно $\Delta L_z = 4-6$ Å (2–3 монослоя) и 6–10 Å (3–4 монослоя).

Спектры образцов № 1 (рис. 1*a*) и № 2, подвергнутого травлению (рис. 3*b*), наиболее просты и поэтому удобны для определения величины диамагнитного сдвига. На рис. 4*b* приведены спектры люминесценции образца № 2, подвергнутого травлению, в магнитном поле, направленном параллельно слоям структуры вдоль оси [211] (т. е. перпендикулярно [111]). В отличие от спектров того же образца, записанных в перпендикулярном поле (рис. 4*a*), интенсивность линии люминесценции экситона слабо зависит от магнитного поля *B*, однако смещение высокоэнергетического крыла линии экситона сравнимо с его смещением в случае **B** || [111]. Спектры, записанные в поле, направленном вдоль оси [011], фактически не отличаются от приведенных на рис. 4*b*. Спектры образца № 1 аналогичны приведенным на рис. 4 спектрам для образца № 2.

Возгорание линии люминесценции экситонов в перпендикулярном магнитном поле вызвано, видимо, уменьшением в магнитном поле длины разлета фотовозбужденных электронно-дырочных пар, что увеличивает вероятность их локализации на флуктуациях случайного потенциала и неоднородностях гетерограницы и последующей излучательной рекомбинации [10].

Оценка величины диамагнитного сдвига линии экситона по положению точки на полувысоте приводит к значению ~ 2 мэВ в поле 14 Тл. Положение аналогичной точки на красном «крыле» фактически не изменяется. Увеличение ширины линии с полем, видимо, есть следствие того, что линия люминесценции имеет сложную природу и состоит из линии свободных и связанных экситонов. Тогда смещение «фиолетового» края линии в магнитном поле будет определяться диамагнитным поведением свободных квазидвумерных экситонов.



Рис. 4. *NP*-компоненты спектров люминесценции образца № 2, подвергнутого травлению, при постоянной накачке Nd:YAG-лазером при *T_b* = 4.2 К в магнитном поле: *a*) В || [111]. Плотностъ лазерной накачки *W* = 50 Вт/см². Интенсивность спектра нормирована на величину интенсивности в максимуме линии *NP*. *б*) В || [211]. Плотностъ накачки *W* = 20 Вт/см²

Для того чтобы определить насколько это предположение оправдано, оценим величину сдвига линии экситона в поле *B*.

Массы дырок в обеих подзонах размерного квантования сильно анизотропны. Низшей энергетической подзоне тяжелых дырок (hh) с большей массой плотности состояний соответствуют следующие значения масс: вдоль оси [111] $m_{\parallel}^{hh} = 0.49m_0$, перпендикулярно по оси [111] $m_{\perp}^{hh} = 0.053 m_0$. Для подзоны легких дырок (lh) имеем $m_{\perp}^{lh} = 0.13m_0, \ m_{\parallel}^{lh} = 0.049m_0 \ (m_0$ — масса электрона) [9]. Дыркам из расщепившихся подзон соответствуют определенные значение проекции полного момента j_z на ось [111]. Для дырок из нижней подзоны $j_z = \pm 3/2$. Под действием одноосной деформации расщепляются уровни в зоне проводимости. Дно зоны проводимости образуют 3 эквивалентных долины, при этом энергия четвертой долины, для которой ось [111] является осью вращения, смещается вверх по отношению к нижним со скоростью ~ 11 мэВ/кбар. Несмотря на значительную анизотропию электронных и дырочных масс, анизотропия масс экситона в квантовой яме $Ge/Ge_{1-x}Si_x$ гораздо меньше. Поверхности постоянной энергии для электронов и дырок суть эллипсоиды вращения, но оси симметрии этих эллипсоидов не совпадают (для дырок это ось [111], а для электронов [111] и эквивалентные). Длинная ось эллипсоида приведенных масс экситона, образованного электроном из любой из эквивалентных долин, составляет угол ~ 21° с осью [111]. Приведенные массы экситона $\mu_1 = 0.045m_0$, $\mu_2 = 0.032m_0$, $\mu_3 = 0.087m_0$. Приведенные массы экситонов в растянутом вдоль оси [111] Ge оказались весьма близки к массам экситонов в Ge, сжатом вдоль оси [100]: $\mu'_1 = 0.047m_0, \ \mu'_2 = 0.031m_0, \ \mu'_3 = 0.083m_0.$ Это позволяет с хорошей точностью воспользоваться результатами вариационных расчетов энергии экситона Ry в деформированном Ge[100], выполненных в работе [11]. Согласно ей Ry $\simeq 2.8$ мэВ. Его размеры, соответствующие приведенным выше массам, $a_1 \approx 170$ Å, $a_2 \approx 200$ Å, $a_3 \approx 140$ Å.

Простая аналитическая модель, учитывающая проникновение волновых функций электронов и дырок в барьеры и хорошо согласующаяся с точными расчетами E_0 для квантовой ямы GaAs/AlGaAs [12], дает $E_0 \approx 2.1 \text{ Ry} \simeq 5.9 \text{ мэВ}$ для ямы с $d_{\text{Ge}} = 120 \text{ Å } \text{ и}$ $E_0 = 1.8 \text{ Ry} \simeq 5 \text{ мэВ}$ для ямы $d_{\text{Ge}} = 210 \text{ Å}$.

Диамагнитная восприимчивость экситона в объемном Ge зависит от масс электронов и дырок и, в отличие от энергии связи, не будет совпадать для Ge, сжатого вдоль оси [100] и растянутого вдоль оси [111]. Но поскольку массы в этих двух случаях близки, значения χ_{ij} , вычисленные в [11], в сжатом Ge[100] и растянутом Ge[111] также близки. Согласно этой теории диагональные элементы тензора диамагнитной восприимчивости $\chi_{ii} \approx 0.3$ –0.5 мэВ/Тл². Кроме того, поправка Ван-Флека к диамагнитной восприимчивости составляет всего лишь несколько процентов от ланжевеновского члена [11].

Для изотропного квазидвумерного экситона (свободного, локализованного или связанного с примесью) диамагнитный сдвиг в слабых полях описывается выражением для ланжевеновской поправки, аналогичной трехмерному случаю [13]: $\Delta E = e^2 B^2 \langle r^2 \rangle / (8\mu_{\perp}c^2), \langle r^2 \rangle \equiv \langle \Psi | r^2 | \Psi \rangle$ — величина, характеризующая область локализации экситона, μ_{\perp} — приведенная масса в плоскости, перпендикулярной полю. В изотропном случае диамагнитная поправка к энергии квазидвумерного экситона в $\langle r^2 \rangle / 2a_B$ меньше, чем в трехмерном случае. Для идеального двумерного экситона это отношение равно 16/3. Локализация экситона на неоднородностях потенциала или примесях в плоскости перпендикулярной полю также приводит к уменьшению ΔE . Следует ожидать, что величина χ_{\parallel}^{2D} окажется в несколько раз меньше, чем в трехмерном случае.

Для того чтобы найти изменения энергии экситона в магнитном поле, кроме диамагнитного сдвига необходимо учитывать линейную по *B* поправку $\Delta E = (1/2)g_{ex}\mu_B B$ (g_{ex} — фактор экситона равный сумме *g*-факторов электрона и дырки). Измерения зависимости положений максимумов шубниковских осцилляций от наклона магнитного поля в селективно легированных бором квантовых ямах Ge/Ge_{1-x}Si_x с параметрами, близкими к параметрам исследуемых квантовых ямах Ge/Ge_{1-x}Si_x с параметрами, близкими к параметрам исследуемых квантовых ям (x = 14%, $d_{Ge} = 110$, 180 Å), показали, что в магнитном поле сохраняется проекция спина дырок на ось [111] [14]. Полученный из этих измерений *g*-фактор дырок оказался равным –5.8. В случае объемного Ge, подвергнутого сильному растяжению вдоль оси [111], $g_h \simeq -7$ [9]. Величина g_e для электронов любой из трех эквивалентных долин в магнитном поле, направленном вдоль оси [111], $g_e \simeq 1$. В магнитном поле **B** \parallel [211] g_e различается для разных долин. Для экситонов с электронами из долины [111] величина диамагнитного сдвига оказалась максимальной. Для электронов из этой долины $g_e \simeq 1.5$.

Таким образом, для **B** || [111] зеемановская компонента в энергии экситона равна $\Delta E \simeq -(7/2)\mu_B B = -0.2B$ мэВ, а для **B** || [211] $\Delta E = -(1/2)\mu_B B \simeq -0.03B$ мэВ. Сдвиг линии в «красную» сторону спектра в малых полях, когда доминирует линейный член, оказывается меньше 0.4 мэВ и в наших экспериментах едва ли мог быть замечен.

Поскольку в параллельном и перпендикулярном плоскости структур полях диамагнитный сдвиг ≈ 2 мэВ в поле 14 Тл, то решая систему из двух уравнений, найдем $\chi_{\parallel} = 0.04 \text{ мэВ/Tл}^2$, а $\chi_{\perp} = 0.03 \text{ мэВ/Tл}^2$. Таким образом, оказывается, что χ двумерного экситона примерно в 8–10 раз меньше, чем трехмерного. Отсюда, пользуясь соотношением $\chi^{3D}/\chi_{\parallel}^{2D} = \langle r^2 \rangle/2a_B^2$ [13], получим размер области локализации квазидвумерного экситона $\sqrt{\langle r^2 \rangle} = 0.4-0.5a_B = 75-90$ Å.

Ширина линии люминесценции экситона в квантовых ямах определяется флуктуациями ширины этих ям и состава твердого раствора. В случае экситонов, локализованных в широких ямах Ge, когда $L_z \ge a_B$, флуктуациями состава твердого раствора можно пренебречь. При гауссовом распределении флуктуаций L_z , ширина линии люминесценции полностью характеризует случайный потенциал [15].

В этом случае, согласно теории [16], линия люминесценции экситона имеет форму гауссова колокола с полушириной

$$\sigma = 1.18 \sqrt{p(1-p)} \delta_z \delta_{xy} |\delta E_{ex}/\delta L_z|_{L_z = L_0}/(2a_\perp),$$

 L_z — ширина ямы, δ_z — величина флуктуаций L_z . Предполагая, что величина флуктуаций δ_z ширины ямы не превышает определенного ранее значения разброса ширины ям, выберем $\delta_z = 10$ Å. Примем p, среднюю долю «островков» и «впадин» в общей площади интерфейса, равной наиболее вероятной величине 0.5. Возьмем для оценки размер экситона в плоскости ямы $a_{\perp} = \sqrt{\langle r^2 \rangle} = 80$ Å. Линия люминесценции экситонов имеет максимальную ширину σ_{max} при характерном размере неоднородностей интерфейса равном случае $\sigma \simeq 2.5$ мэВ. При облучении исследуемых образцов светом Ar⁺-лазера в формировании линий люминесценции участвует лишь несколько приповерхностных квантовых ям. Минимальная ширина линий люминесценции оказалась 4.5–5 мэВ. Так как энергия связи экситона на примесях в слоях Ge равна 1.5–2 мэВ [5], полученная оценка ширины линии достаточно хорошо совпадает с наблюдаемой σ .

Недавние исследования локализации экситонов в напряженных структурах InGaAs/GaAs показали определенную независимость величины стоксова сдвига и ширины линии люминесценции [17], что указывает на негауссово распределение случайного потенциала в этих структурах и является следствием релаксации упругой энергии гетерограниц.

Видимо, это также верно для исследуемых напряженных структур $Ge/Ge_{1-x}Si_x$. Тогда, несмотря на то что приведенная выше оценка σ согласуется с измеренной, ширина линии люминесценции не может служить однозначной характеристикой случайного потенциала.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе показано, что представление о диамагнитном поведении квазидвумерных свободных и связанных на примесях экситонов, локализованных в слоях Ge, объясняет наблюдаемые факты. Поскольку диамагнитный сдвиг связанного на примесях экситона меньше, чем свободного, наблюдаемое увеличение ширины линии люминесценции подтверждает предположение о ее составном характере. Величина диамагнитного сдвига экситона позволила оценить размер экситона в плоскости квантовой ямы. В то же время никаких указаний на существование биэкситонов в рассматриваемых структурах нами получено не было. Авторы выражают признательность 3. Ф. Красильнику и В. Д. Кулаковскому за содействие при выполнении работы и полезные обсуждения, В. Б. Тимофееву за замечания по тексту статьи.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты 29-02-17535 и 96-02-16991) и программы «Физика наноструктур» (проекты 97-1065 и 96-2011).

Литература

- 1. U. König, Physica Scripta 68, 90 (1996).
- T. W. Steiner, L. C. Lenchyshyn, M. L. W. Thewalt et al., Sol. St. Com. 89, 429 (1994);
 M. L. W. Thewalt, *Extended abstracts of 1993 Int. Conf. on Solid State Devices and Matherials* (SSDM-93), Makuhari, Japan (1993), p. 494.
- 3. J. C. Sturm, H. Monoharan, L. C. Lenchyshyn et al., Phys. Rev. Lett. 66, 1362 (1991).
- 4. Н. Г. Калугин, Л. К. Орлов, О. А. Кузнецов, Письма в ЖЭТФ 58,197 (1993).
- 5. L. K. Orlov, V. Ya. Aleshkin, N. G. Kalugin et al., J. Appl. Phys. 80, 415 (1996).
- 6. В. Д. Кулаковский, В. Г. Лысенко, В. Б. Тимофеев, УФН 147, 3 (1985).
- 7. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Квантовая механика, Наука, Москва (1989), с. 5.
- 8. В. Я. Алешкин, Н. А. Бекин, ФТП 31, 171 (1997).
- 9. Г. Л. Пикус, Г. Е. Бир, Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках, Наука, Москва (1972).
- 10. K. Fujii, T. Tomaru, T. Ohayama, and E. Otsuka, in *High magnetic field in semiconductor physics*, ed. by G. Landwehr, Springer-Verlag (1989), p. 558.
- 11. Т. Г. Тратас, В. М. Эдельштейн, ЖЭТФ 81, 698 (1981).
- 12. H. Mathieu, P. Lefebre, and P. Christol, Phys. Rev. B 46, 4092 (1992).
- 13. W. Ossau, B. Jäkel, E. Bangert et al., Surf. Sci. 174, 188 (1986).
- 14. Н. А. Городилов, О. А. Кузнецов, Л. К. Орлов и др., Письма в ЖЭТФ 56, 409 (1992).
- 15. F. Yang, M. Wilkinson, E. J. Austin et al., Phys. Rev. Lett. 70, 333 (1993).
- 16. J. Singh and K. K. Bajaj, J. Appl. Phys. 57, 5433 (1985).
- 17. W. Broun, L. V. Kulik, T. Baars et al., submitted to Phys. Rev. B (1998).